

半導体を中心とする電子デバイスのプロセス技術において、材料表面を清浄化・改質する技術はデバイス界面の信頼性に対して極めて重要である。また、ウェットプロセスを用いた新規なエッチングや薄膜を形成する技術は、デバイスの微細化・三次元化のひとつのテクノロジードライバである。本研究会は界面ナノ現象を明らかにすることでウェットプロセスに関する学問を構築し、次世代へと教育できる環境を整えている。同時に本研究会成果物の実行者である若手の主体性が極めて重要であることから、若手の主体性強化を目的としたポスター発表展を2015年より企画している。若手技術者とベテラン技術者とのFace to Faceの活発な議論を期待して、下記の要項で第7回ポスター展を開催する。

若手のポスター発表展 ーベテランとの議論に打ち勝て！ー

- 主催：公益社団法人 応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会
- 日時：2022年9月29日(木) 13:00~17:40
- 会場：ナガセ グローバル 人財開発センター(東京都渋谷区千駄ヶ谷)
現地発表+オンラインポスター掲載

- 開催概要：招待講演 1件
佐藤 雅伸氏「回転基板上のLES-VOF法を使用した流体シミュレーション」
(株式会社SCREEN セミコンダクターソリューションズ)
ポスター発表 21件(予定)

- ポスター掲載期間：2022年9月26日(月) ~ 10月7日(金)
※LINC Bizを使用したオンライン掲載を行います。
※事前登録後、掲載アドレスを案内します。

- 参加費：2000円(学生無料)

- 申込方法：<https://forms.gle/SQTxfDyWyZL4TCtN8>
参加申込先URLもしくはQRコードより、アンケートにご回答頂く形で申し込みをお願いします。
申し込み用Googleフォームにアクセスできない際は、下記世話役へご連絡ください。

- 申込締切：2022年9月15日(木) ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください

- ポスター発表展終了後、会場周辺(代々木駅近く)にて第31回カサロス(懇親会)を開催します。

- 世話役：
オルガノ 蔦野恭平 tsutano-k@organo.co.jp
日本インテグリス 永淵琢也 takuya.nagafuchi@entegris.com

参加申込先



時刻	内容
13:00-13:10	開会挨拶：岩元委員長
13:10-13:55	招待講演：佐藤 雅伸氏 (株式会社SCREEN セミコンダクターソリューションズ) 「回転基板上のLES-VOF法を使用した流体シミュレーション」
13:55-15:00	ライトニングトーク
15:00-15:10	休憩(レイアウト変更)
15:10-16:10	ディスカッション(コアタイム奇数番号)
16:10-17:10	ディスカッション(コアタイム偶数番号)
17:10-17:20	INE活動予定：吉水副委員長
17:20-17:40	表彰式&閉会挨拶：有馬副委員長 集合写真撮影
18:15-20:15	第31回カサロス(懇親会)

会場案内



タイトル	発表者	所属
1 ICP-MSによるウェーハ表面の極微量金属汚染の分析手法構築	岩井 繁幸	東京エレクトロン株式会社
2 次世代ウェーハの微小領域における超微量金属不純物測定手法の開発 ~ LA-GED-ICP-MS	鈴木 幸志	株式会社イアス
3 機能水中でのIII-V族化合物半導体 (InP) の表面反応分析	西尾 賢哉	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
4 GaAs加工後洗浄プロセス後の基板表面解析	平野 智暉	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
5 GaAs基板と無電解Ni-Pめっき膜の熱処理による界面反応	西澤 弘一郎	三菱電機株式会社
6 Characterization and Removal of Metallic Contamination in H ₂ O and H ₂ O ₂ Using SP-ICP-MS	近藤 一彦	日本インテグリス合同会社
7 フローインジェクション法を用いた超純水製造向けオンライン尿素計の開発	塩谷 惟	オルガノ株式会社
8 IPA乾燥速度に着目したパターン倒壊の新たな動的流体モデル	塚原 隆太	株式会社SCREEN セミコンダクターソリューションズ
9 枚葉式洗浄における気液二相流解析へのOpenFOAMの適用：化学洗浄（液膜流れと薬液分布）から物理洗浄（二相噴流）まで	神保 佳典	静岡大学
10 ウエハー上で相対運動するPVAブラシのノジュール接触軌跡解析	鈴木 翔大	静岡大学
11 異なるメガヘルツ帯振動体超音波洗浄法によるパーティクルの除去率評価	高木 羅以	愛知工業大学
12 強電界を利用した二流体スプレー洗浄時の静電気障害防止技術	鈴木 洋陽	愛知工業大学
13 湿式法によるSi(111)表面のステップ端に沿ったナノ溝構造の自己組織的形成	竹内 鉄朗	大阪大学
14 サブ分子層レベルの水分子吸着履歴を持つGeO ₂ /Ge構造の電気特性測定法の開発	佐野 修斗	大阪大学
15 ルテニウムおよびカーボン膜に対する光電気化学エッチングの検討	樋口 倫太郎	東京エレクトロン九州株式会社
16 O ₃ ガスベークとウェット処理を組み合わせたモリブデンのデジタルエッチング	石津 岳明	株式会社SCREEN セミコンダクターソリューションズ
17 ペロブスカイト太陽電池の発電層のスプレートリートメントの表面モロロジー評価	田中 一成	愛知工業大学
18 ペロブスカイト太陽電池のカラー化に向けた誘電体ミラー作製技術	五十川 裕哉	愛知工業大学
19 電気伝導度を設計指針とした高い剥離性と金属防食性を有するレジスト剥離液の開発	佐々木 遼	関東化学株式会社
20 酸化膜材表面上のナノスケール洗浄現象観察	寺山 裕	九州工業大学
21 4H-SiC表面上の磁性コア・ナノ粒子挙動観察	P., Thitipat	九州工業大学

カサロス（懇親会）の詳細ご案内

- 主催：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会
- 日時：2022年9月29日(木) 18:15~20:15
- 参加費：5,000円（学生無料）
※当日会場にてお支払い下さい。領収書を発行します。
- 申込締切：2022年9月15日(木)
- 定員：50名 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください

カサロス会場案内

ポスター会場より徒歩約10分

Di PUNTO

ディプント代々木店

Tel.03-6276-7821

東京都渋谷区代々木1-32-11 代々木Kビル2F

【月～金】17:00-3:00

【土】16:00-3:00

【日・祝】16:00-23:00

※状況により営業時間に変更となる場合がございます。

www.dipunto.wine



- 参加申込方法：
メールに記載のURLもしくは右のQRコードよりアンケートに回答する形で参加意思表示を
よろしく申し上げます。

